

<b>NAR Labs</b> 國家實驗研究院 國家奈米元件實驗室	文件編號 DOCUMENT NO.	S3-NL05
	總頁數 TOTAL PAGE	共 14 頁
文件名稱 TITLE	儀器設備作業標準(CF-L19 可變型束電子束曝光機)	

機台名稱：可變型束電子束曝光機

機台編號：CF-L19

制訂部門：奈米元件廠

制訂日期：2012/10/01

文件制修訂記錄

NO	發行日期	修訂申請書編號	制修訂內容	修訂頁次	版本
01	2012/10/01	-----	制定初版	-----	1.0
02	2013/07/01	102-DC09	修改表首 logo 及制訂部門名稱 修改	ALL	2.0
03					
04					
05					
06					
07					
08					

核 准	審 查	制 訂

<b>NAR Labs</b> 國家實驗研究院 國家奈米元件實驗室		DOCUMENT NO. : S3-NL05	TITLE : 儀器設備作業標準 (CF-L19 可變型束電子束曝光機)		
ISSUE DATE	2013/07/01	REVISION	2.0	PAGE	第 1 / 13 頁

一、目的：

定義可變型束電子束曝光機操作規範，以確保操作品質。

二、範圍：

適用於可變型束電子束曝光機。

三、權責：

1. 組織權責：工程師負責制定及修改規範。
2. 執行人員資格：經過可變型束電子束曝光機考核通過之人員。

四、名詞定義：

無。

五、相關文件：

VISTEC SB350 OPERATOR MANUAL

六、標準作業程序：

1. 檢查機台運轉告示牌是否為運轉中，如圖 1，並翻閱使用紀錄表查看機台狀態是否正常。若有異常請勿操作機台，若為正常則可操作機台，並填寫使用紀錄表。



圖 1

<b>NAR Labs</b> 國家實驗研究院 國家奈米元件實驗室		DOCUMENT NO. : S3-NL05	TITLE : 儀器設備作業標準 (CF-L19 可變型束電子束曝光機)		
ISSUE DATE	2013/07/01	REVISION	2.0	PAGE	第 2 / 13 頁

2. 檢查左螢幕畫面：右上方狀態指示燈應為黃色閃爍，左下方 Jobs 分頁鍵應為綠色底色 Jobs，右下方 Alarms 分頁鍵應為灰色底色 Alarms。如圖 2 所示，此時機台為待機狀態，可正常操作使用。

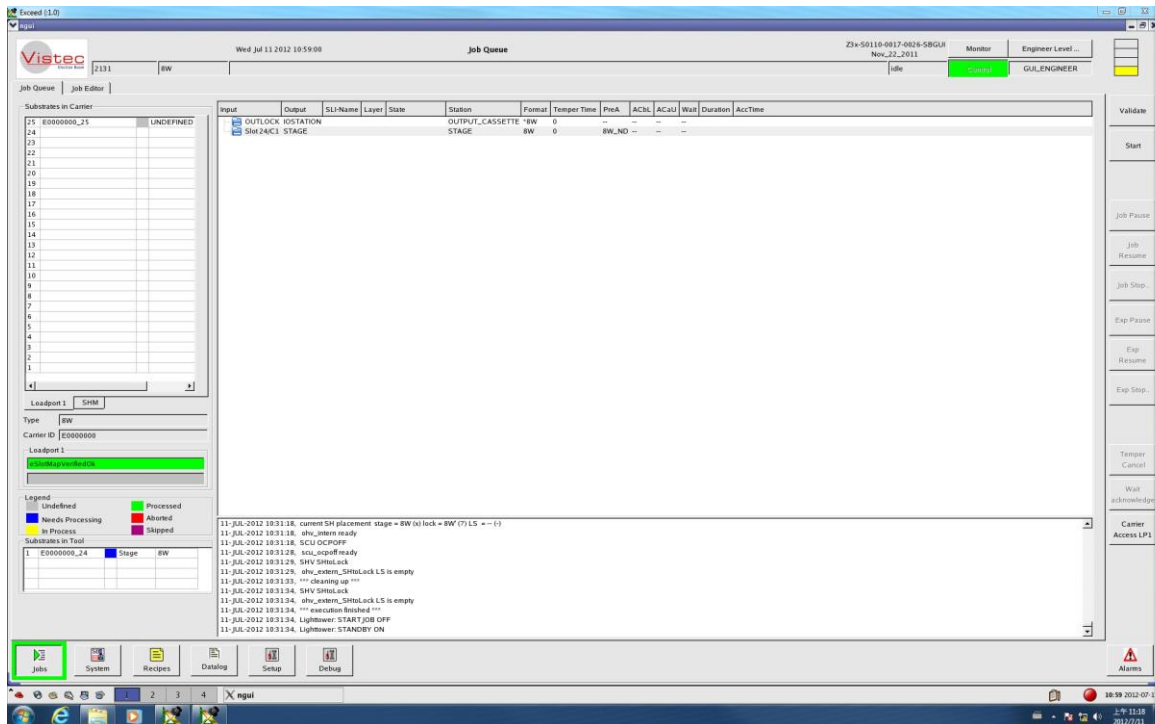


圖 2

<b>NAR Labs</b> 國家實驗研究院 國家奈米元件實驗室		DOCUMENT NO. : S3-NL05	TITLE : 儀器設備作業標準 (CF-L19 可變型束電子束曝光機)		
ISSUE DATE	2013/07/01	REVISION	2.0	PAGE	第 3 / 13 頁



3. 按下  功能鍵將 FOUP 退出 load port，此右方螢幕會出現  警示訊息，如圖 3a。待 load port 上方 unload 燈亮後，如圖 3b，取下 FOUP 置於工作桌上。



圖 3a

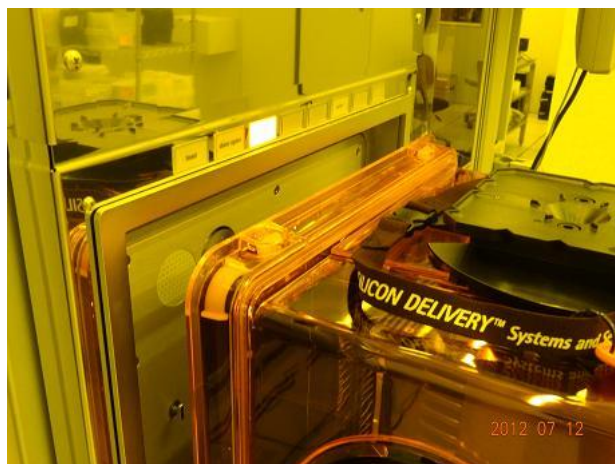


圖 3b

<b>NAR Labs</b> 國家實驗研究院 國家奈米元件實驗室		DOCUMENT NO. : S3-NL05	TITLE : 儀器設備作業標準 (CF-L19 可變型束電子束曝光機)		
ISSUE DATE	2013/07/01	REVISION	2.0	PAGE	第 4 / 13 頁

4. 以鑰匙開啟盒蓋，開啟盒蓋切勿使用蠻力，注意盒蓋鑰匙孔周圍有細線條紋，請將圓形塑膠珠子旋轉推至條紋另一端即可開啟盒蓋，上鎖則反向操作即可，如圖 4a 所示，兩個鑰匙孔必需都開啟方可取下盒蓋，取下後請小心放置妥當位置，如圖 4b。取出已曝光之晶圓，放入待曝光之晶圓後，將 FOUP 放回 load port，按下 load 鍵，如圖 4c。

**注意：禁止晶圓破損、斜插、疊片、正反面錯置、晶背髒污、薄膜脫落、變形等情況進行曝光。**

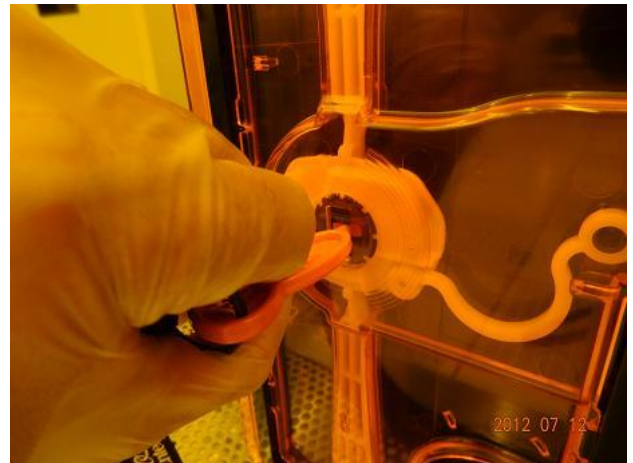
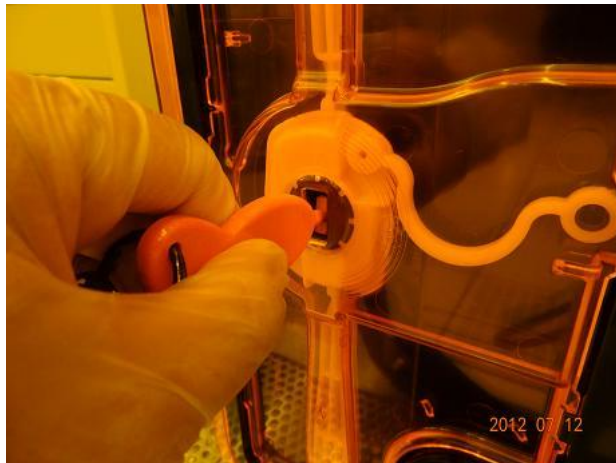


圖 4a

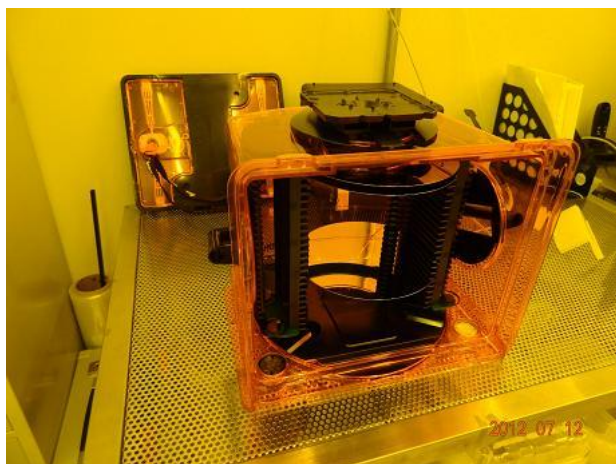


圖 4b

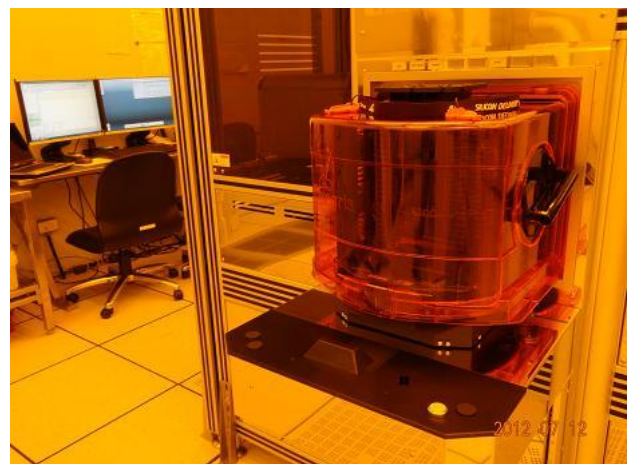


圖 4c



<b>NAR Labs</b> 國家實驗研究院 國家奈米元件實驗室		DOCUMENT NO. : S3-NL05	TITLE : 儀器設備作業標準 (CF-L19 可變型束電子束曝光機)		
ISSUE DATE	2013/07/01	REVISION	2.0	PAGE	第 5 / 13 頁

5. 確認左方螢幕左方 Substrates in Carrier 欄位內機台讀取之晶圓位置及數量正確，如圖 5 所示。

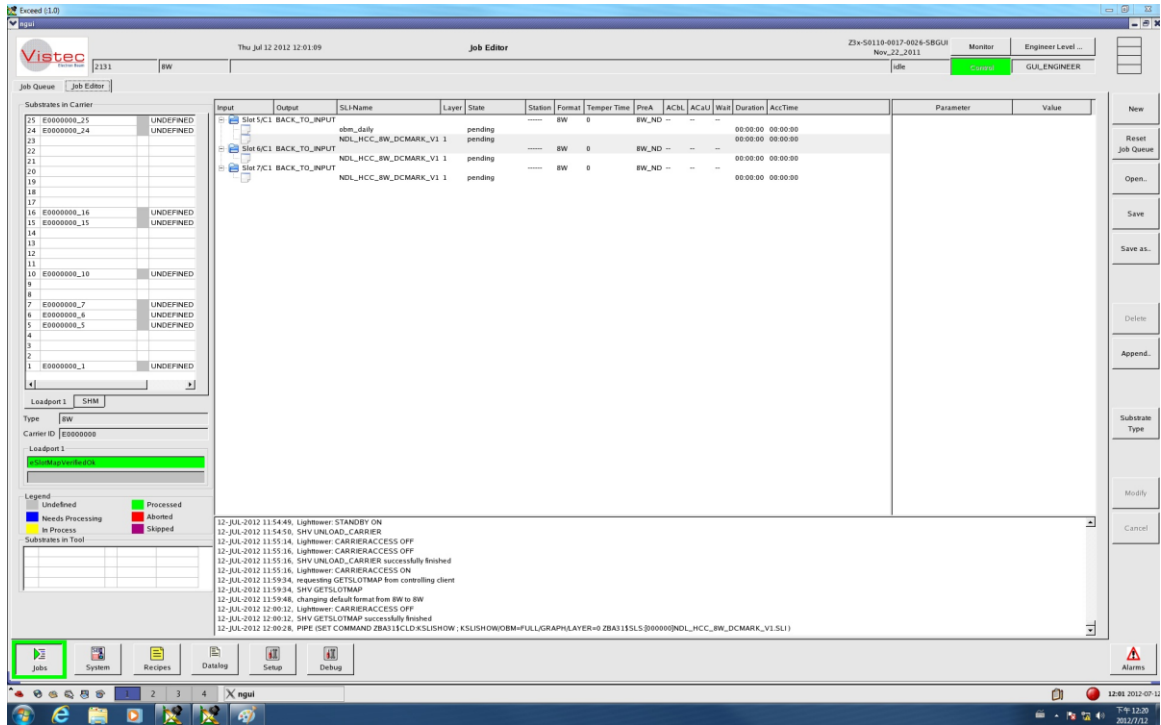

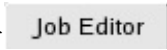



圖 5

<b>NAR Labs</b> 國家實驗研究院 國家奈米元件實驗室		DOCUMENT NO. : S3-NL05	TITLE : 儀器設備作業標準 (CF-L19 可變型束電子束曝光機)		
ISSUE DATE	2013/07/01	REVISION	2.0	PAGE	第 6 / 13 頁

6. 按  鍵並按左上方  子分頁，按下右上方功能鍵 ，在彈出 Format 視窗之下拉選單選擇 Format-8W，Prealigner-8W\_ND，如圖 6 所示，並按 OK 確認。

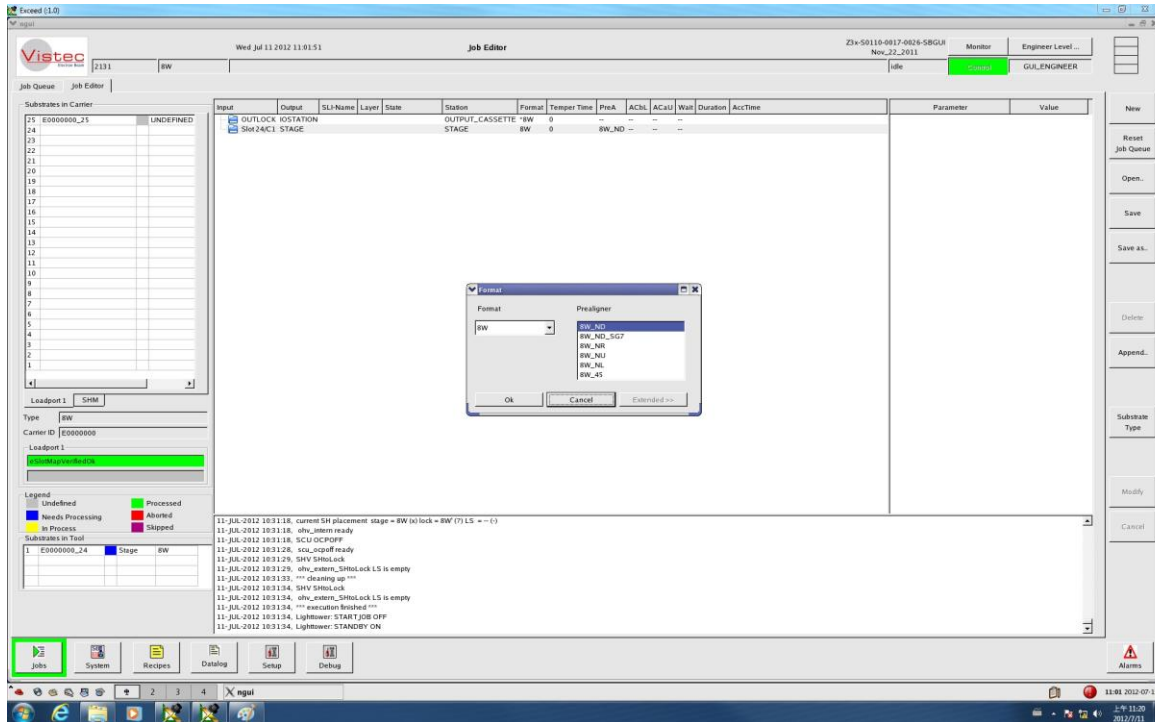


圖 6

<b>NAR Labs</b> 國家實驗研究院 國家奈米元件實驗室		DOCUMENT NO. : S3-NL05	TITLE : 儀器設備作業標準 (CF-L19 可變型束電子束曝光機)		
ISSUE DATE	2013/07/01	REVISION	2.0	PAGE	第 7 / 13 頁

7. 按右方 **Append..** 功能鍵，彈出 Add SLI/Script 視窗，左方 Add To Queue 可選擇曝光晶片，中間 Add 可選擇愈曝光之 SLI 及 Script，右方 Job Queue 為曝光排程，如圖 7 所示。

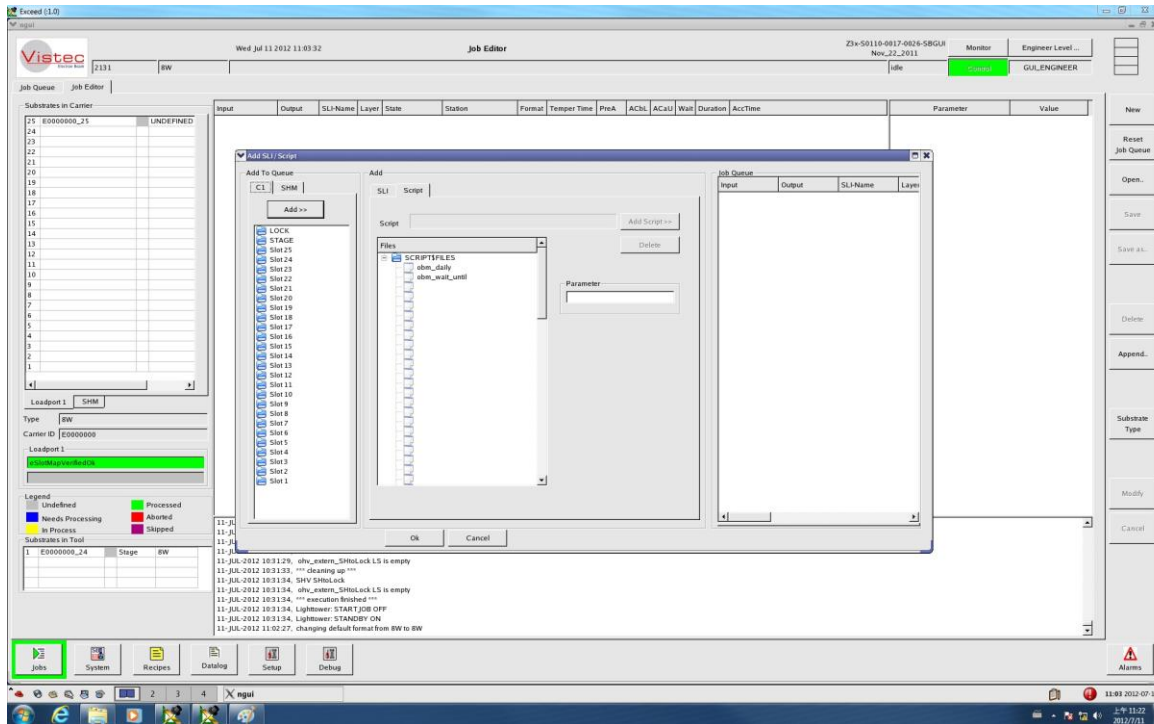


圖 7

**注意：**由於每日必須做機台參數校正，因此藉用每日第一批曝光排程的第一片晶圓來進行機台參數校正，當日第二批以後之曝光排程則無須再進行機台參數校正工作。每日機台參數校正之執行檔為 Script 子分頁中的 **obm\_daily** 檔案。



<b>NAR Labs</b> 國家實驗研究院 國家奈米元件實驗室		DOCUMENT NO. : S3-NL05	TITLE : 儀器設備作業標準 (CF-L19 可變型束電子束曝光機)		
ISSUE DATE	2013/07/01	REVISION	2.0	PAGE	第 8 / 13 頁

8. SLI 子分頁中 Filter 可提供曝光檔名關鍵字篩選，如曝光檔名內有 gate 字，則於 filter 欄位內輸入\*gate\*.SLI，再按 ，即可篩選出所有檔名內含 gate 字的 SLI 檔，如圖 8 所示。

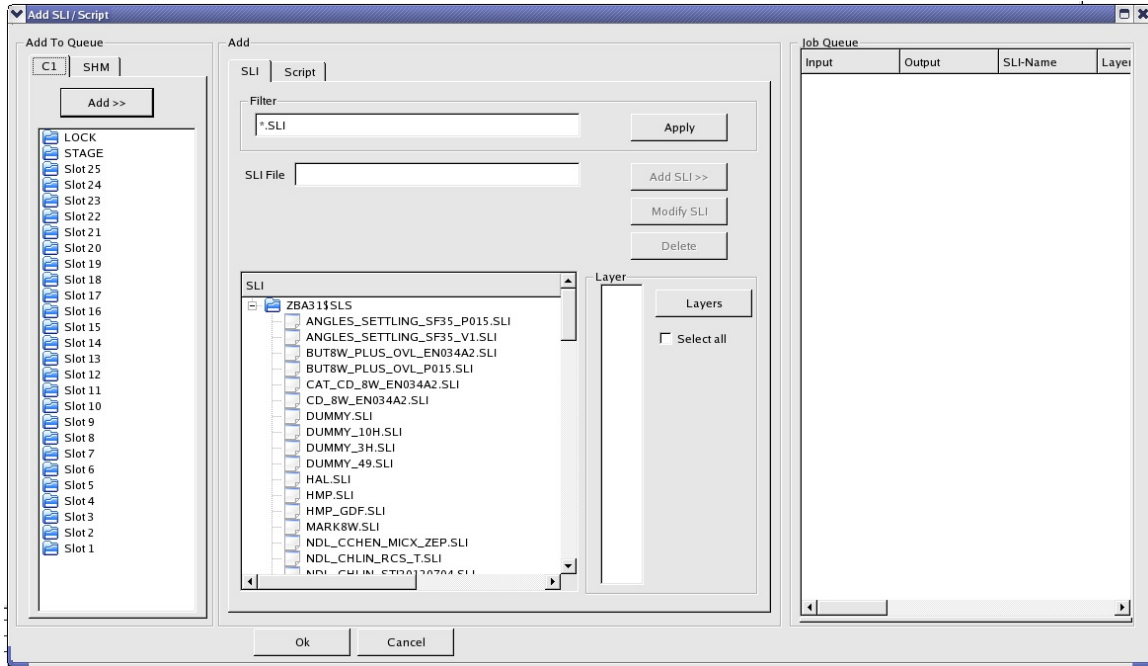


圖 8

<b>NAR Labs</b> 國家實驗研究院 國家奈米元件實驗室		DOCUMENT NO. : S3-NL05	TITLE : 儀器設備作業標準 (CF-L19 可變型束電子束曝光機)		
ISSUE DATE	2013/07/01	REVISION	2.0	PAGE	第 9 / 13 頁

9. 舉例說明，如欲曝光的晶圓放置在 FOUP 盒中第 5、6、7 格，欲曝光檔名為 NDL\_HCC\_DCMARK\_V1.SLI，且為當日第 1 批曝光排程。

編排方法如下：

- 選擇 Slot5 —  — 選擇 obm\_daily —  — 選擇 NDL\_HCC\_DCMARK\_V1.SLI —
- 選擇 Slot6 —  — 選擇 NDL\_HCC\_DCMARK\_V1.SLI —
- 選擇 Slot7 —  — 選擇 NDL\_HCC\_DCMARK\_V1.SLI —
- 。編排完成後將如圖 9 所示。

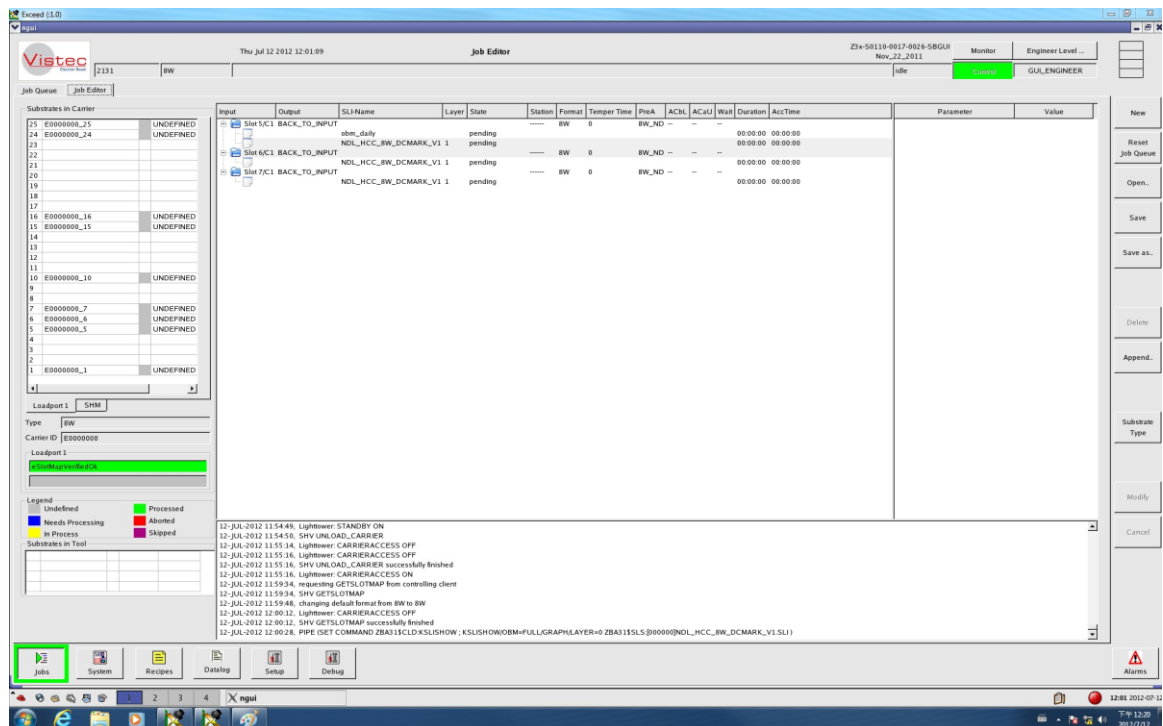


圖 9

附註：SB350 的標準零層對準標記曝光檔名為 NDL\_HCC\_DCMARK\_V1.SLI。

<b>NAR Labs</b> 國家實驗研究院 國家奈米元件實驗室		DOCUMENT NO. : S3-NL05	TITLE : 儀器設備作業標準 (CF-L19 可變型束電子束曝光機)		
ISSUE DATE	2013/07/01	REVISION	2.0	PAGE	第 10 / 13 頁

10. 切換至 **Job Queue** 子分頁進行自動檢查，按右上方 **Validate** 功能鍵，並等待下方訊息視窗顯示 **\*\*\*\*\* startcheck test finished successfully \*\*\*\*\***，表示檢查完成無誤，可按下右上方 **Start** 功能鍵執行曝光作業，如圖 10 所示。

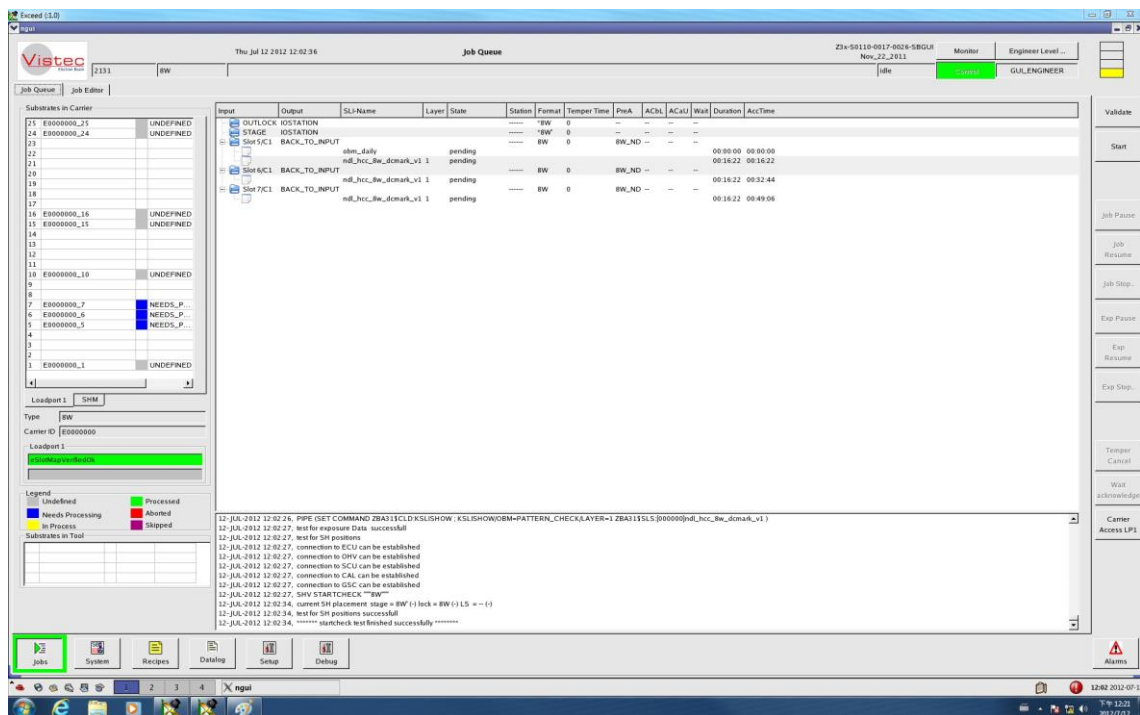


圖 10

<b>NAR Labs</b> 國家實驗研究院 國家奈米元件實驗室		DOCUMENT NO. : S3-NL05	TITLE : 儀器設備作業標準 (CF-L19 可變型束電子束曝光機)		
ISSUE DATE	2013/07/01	REVISION	2.0	PAGE	第 11 / 13 頁

11. 曝光作業全部完成後，畫面將回到步驟 2 狀態，可依照步驟 3、4 取出晶圓。若曝光作業尚未全部完成，但欲取出已完成曝光的晶圓，可以依照以下方式操作。切換至 **Device State** 分頁檢查機台狀態，確認 inner door 與 outer door 皆為關閉狀態，示意圖中未出現任何傳送動作之箭頭符號，Vacuum Lock 之 RV2 值為 1.0e03 以下，如圖 11 所示。

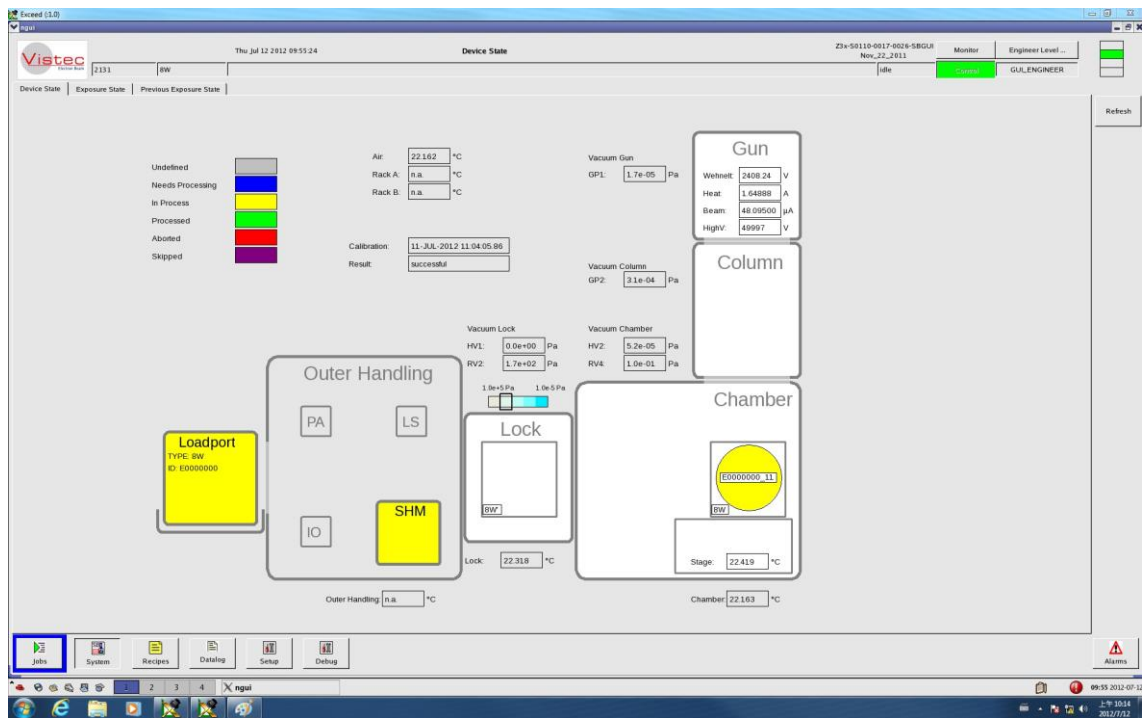

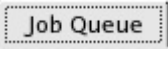





圖 11

<b>NAR Labs</b> 國家實驗研究院 國家奈米元件實驗室		DOCUMENT NO. : S3-NL05	TITLE : 儀器設備作業標準 (CF-L19 可變型束電子束曝光機)		
ISSUE DATE	2013/07/01	REVISION	2.0	PAGE	第 12 / 13 頁

12. 切換至  **Jobs** —  **Job Queue** 分頁，按下畫面右方  **Job Pause** 功能鍵，如圖 12a 所示，再按下  **Carrier Access LP1** 將 FOUP 退出 load port，重複步驟 3、4、5 將已曝光晶圓收取放置在標示「CF-L19 SB350 已曝光」黑色晶片盒，並確認機台讀取之晶圓位置及數量正確後，按下  **Job Resume** 使機器繼續曝光作業，如圖 12b 所示。

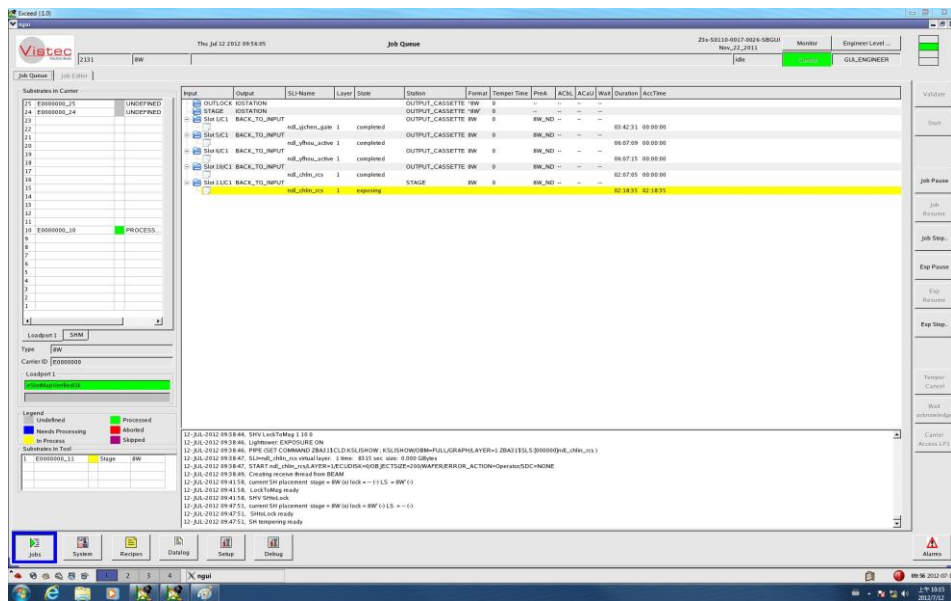


圖 12a

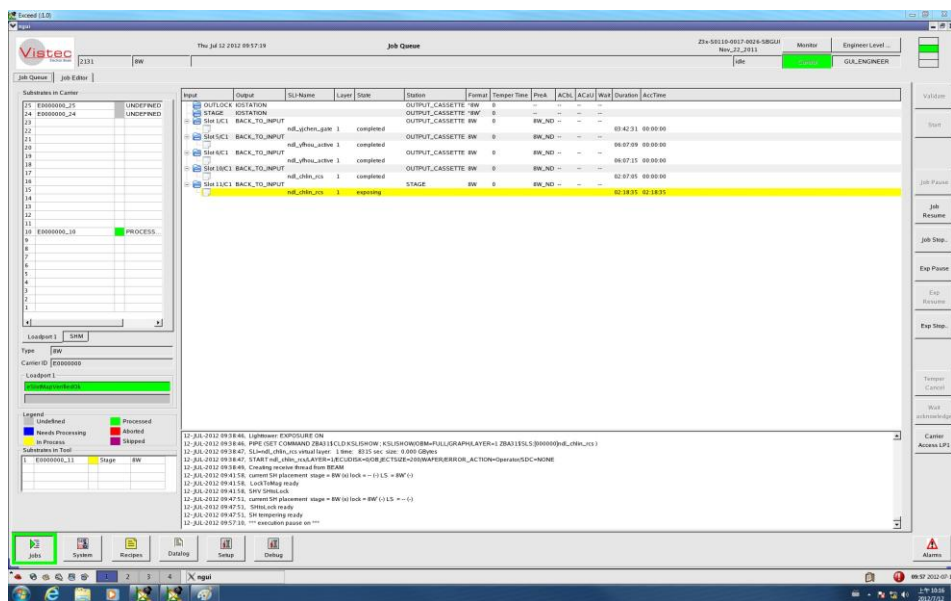



圖 12b

 <b>國家實驗研究院</b> 國家奈米元件實驗室		DOCUMENT NO. :	TITLE :		
		S3-NL05	儀器設備作業標準 (CF-L19 可變型束電子束曝光機)		
ISSUE DATE	2013/07/01	REVISION	2.0	PAGE	第 13 / 13 頁

13. 操作機台時若遇到警示訊息請勿自行排除，應立即通知負責工程師處理，如為下班時間，請留言在使用記錄表或語音信箱中，並將過程詳實登記於使用紀錄表與異常及矯正預防處理單中。

七、 應用表單及附件：

1. 設備考核表 S4-NL01A
2. 設備點檢表 S4-NL01B
3. 設備使用記錄表 S4-NL01C
4. 異常及矯正預防處理單 S4-NL02A
5. 儀器設備管理卡 S4-NL04B